

2018 年

- 2018-J1(C) リン酸塗布方式エキシマレーザードーピングを施した低温多結晶 Si 薄膜の電気特性
第 79 回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集, (公益社団法人応用物理学会), 20a-233-4, 2018 年 9 月
妹川 要, 田中 希, 諏訪 輝, 中村 大輔, 佐道 泰造, 後藤 哲也, 池上 浩
- 2018-J2(C) 局所レーザーアニール法を用いた低温多結晶 Si 薄膜の結晶成長制御
第 79 回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集, (公益社団法人応用物理学会), 20a-233-5, 2018 年 9 月
山田 貴大, 妹川 要, 中村 大輔, 後藤 哲也, 池上 浩
- 2018-J3(C) ミニマルファブ用ミラー磁場閉じ込めプラズマ CVD 装置によるシリコン窒化膜形成
第 79 回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集, (公益社団法人応用物理学会), 21a-233-12, 2018 年 9 月
後藤 哲也, 小林 誠二, 藪田 勇氣, 須川 成利, 原 史朗
- 2018-J4(W) ソースとドレインが非対称の MOSFET を用いた電気的特性ばらつきの統計的解析
電子情報通信学会技術研究報告, シリコン材料・デバイス研究会(一般社団法人電子情報通信学会), SDM2018-62(2018-10), pp.51-56, 2018 年 10 月
市野 真也, 寺本 章伸, 黒田 理人, 間脇 武蔵, 諏訪 智之, 須川 成利
- 2018-J5(W) 原子オーダーで平坦なシリコン表面と その上に形成された MOS デバイスの特性
Readout No.51, pp. 44-49, 2018 年 10 月
寺本章伸
- 2018-J6(W) 先進半導体センサ・デバイス開発プロジェクトの展開
第 30 回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング, pp.53-63, 2018 年 11 月
須川 成利